

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 5 月 12 日 (12.05.2005)

PCT

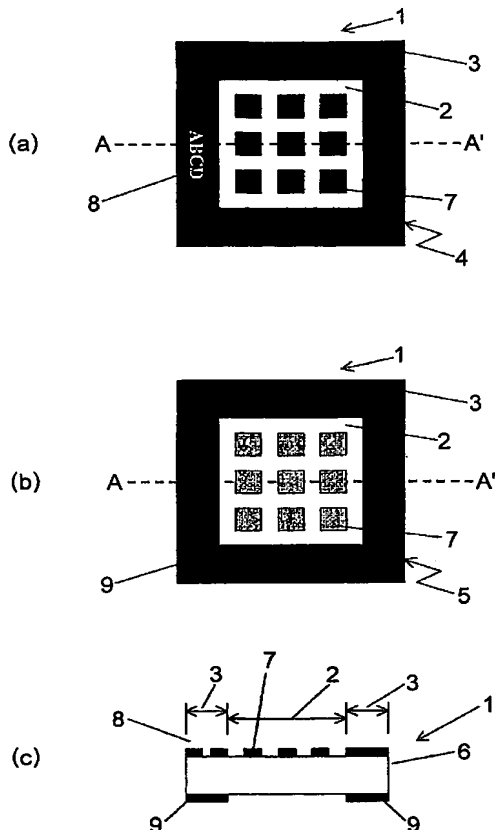
(10) 国際公開番号
WO 2005/043242 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G03F 1/08 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016177 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岩永 義徳 (IWANAGA, Yoshinori).
(22) 国際出願日: 2004 年 10 月 25 日 (25.10.2004) (74) 代理人: 後藤 洋介, 外 (GOTO, Yosuke et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋 1 丁目 4 番 10 号 第三森ビル Tokyo (JP).
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(30) 優先権データ:
特願 2003-370938
2003 年 10 月 30 日 (30.10.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): HOYA 株式会社 (HOYA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1618525 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号 Tokyo (JP).

/ 続葉有 /

(54) Title: PHOTOMASK AND VIDEO DEVICE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: フォトマスク及び映像デバイスの製造方法



(57) Abstract: A photomask in which a device pattern composed of a light-shielding film pattern is formed in a transfer area on the surface of a transparent substrate. In a non-transfer area in the peripheral part of the photomask, a non-device pattern such as a product identification pattern composed of a light-shielding film pattern is formed. On the back of the transparent substrate, in a position opposed to the position where at least the non-device pattern is formed, a light-transmission reducing thin film is provided as a light transmission reducing means for reducing the transmission of the exposure light falling on the peripheral part of the back of the transparent substrate.

(57) 要約: 透光性基板の表面の転写領域に遮光性膜パターンからなるデバイスパターンが形成されたフォトマスクであって、該フォトマスクは、周辺部における非転写領域に遮光性膜パターンからなる製品識別パターン等の非デバイスパターンを有し、少なくとも該非デバイスパターンが形成されている位置と対向する透光性基板の裏面に、該透光性基板の裏面の周辺部から入射する露光光の透過を低減する光透過低減手段として、光透過低減薄膜を設けている。



(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書